

ОБ АНИЗОТРОПИИ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

*Л.И.Буравов¹⁾, Л.Я. Винников, Г.А. Емельченко, П.А. Кононович,
В.Н.Лаухин¹⁾, Ю.А. Осипьян, И.Ф. Щеголев*

Проведены измерения удельного сопротивления нескольких кристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ в плоскости ab и в направлении оси c . Большая величина анизотропии и малая величина по-перечного критического тока указывают, скорее всего, на значительную неоднородность кристаллов в направлении оси c , приводящую к образованию множественных джозефсоновских переходов.

Прогресс в изучении природы высокотемпературного сверхпроводящего состояния сложных оксидов меди^{1,2} невозможен без детального исследования монокристаллических образцов. Между тем, ввиду трудности получения монокристаллов этих соединений к настоящему времени имеется лишь ограниченное число работ, посвященных их изучению, и многие вопросы еще ждут своего выяснения. В настоящем письме мы сообщаем об измерениях температурной зависимости удельных сопротивлений $\rho_{||}$ и ρ_{\perp} монокристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$, соответственно, в плоскости ab и вдоль оси c , а также об измерении критического тока I_{\perp} вдоль оси c .

Монокристаллы были выращены из раствора в расплаве методом, описанным в³. Измерение $\rho_{||}(T)$ и $\rho_{\perp}(T)$ проводилось на постоянном токе методом Монтгомери⁴ с модификациями, описанными в⁵. Модификации заключались в использовании неточечных контактов и учете конечного расстояния между контактами и краями кристалла. Использовались платиновые контакты $\varnothing 10 \mu\text{m}$, подклеиваемые графитовой пастой, с типичными сопротивлениями $\sim 10^2 \Omega$.

Зависимости $\rho_{||}(T)$ четырех монокристаллов приведены на рис. 1, на вставке к которому показан способ размещения контактов²⁾. Обращает на себя внимание заметный разброс свойств кристаллов. При переходе от кристалла № 1 к кристаллу № 4 $\rho_{||}(293)$ уменьшается от 520 до 260 мкОм · см, а T_c растет от 80 до 92 К. При этом отношение $\rho_{||}(293)/\rho_{||}(95)$ увеличивается от 2,6 до 4,3. Заметим, что у кристалла № 4 зависимость $\rho_{||}(T)$ линейна в интервале от 300 до 120 К. В менее совершенных кристаллах 1–3 отклонения от линейности при понижении температуры начинаются раньше.

Зависимости $\rho_{\perp}(T)$ для тех же кристаллов показаны на рис. 2 (для кристаллов №№ 2 и 3 величины ρ_{\perp} практически одинаковы). При величине измерительного тока 0,5 мА сверхпроводящий переход, регистрируемый по $\rho_{\perp}(T)$ слегка сдвинут в сторону более низких температур по сравнению с переходом, регистрируемым по $\rho_{||}(T)$. Вычисление ρ_{\perp} в той области температур, где продольное сопротивление уже отсутствует и формулы Монтгомери не применимы, проводилось в предположении, что ρ_{\perp} пропорционально напряжению V_{12} (при токе через контакты 34), поскольку пары контактов 13 и 24 (см. рис. 1) расположены в этом случае на эквипотенциальных плоскостях. Заметим, что ρ_{\perp} кристалла № 4 падает при охлаждении от 293 до 170 К.

Отношение $\rho_{\perp}/\rho_{||}$ при 293 К меняется от 120 для кристалла № 1 до 48 для кристалла № 4. При понижении температуры ρ_{\perp} растет, а $\rho_{||}$ падает, и при 95 К величина $\rho_{\perp}/\rho_{||}$ достигает значений 600–700 для кристаллов 1–3 и равно 230 для кристалла № 4. Даже последняя величина почти на порядок превышает значение ~ 25 , которое можно ожидать из соотношения $\rho_{\perp}/\rho_{||} \approx (H_{c2||}/H_{c2\perp})^2$, используя величины H_{c2} , измеренные в⁶.

¹⁾ Отделение института химической физики АН СССР.

²⁾ В методе Монтгомери удельные сопротивления $\rho_{||}$ и ρ_{\perp} вычисляются, исходя из геометрических размеров кристалла, по напряжениям V_{\perp} и $V_{||}$ на контактах 12 и 13, возникающим при пропускании тока, соответственно, через контакты 34 и 24.

Скорее всего, причиной такого расхождения является неоднородность имевшихся в нашем распоряжении кристаллов в направлении оси *c* и, как следствие — несобственный характер возрастания ρ_{\perp} при понижении температуры. Однако тщательное исследование локальной кристаллической структуры образцов на сканирующем электронном микроскопе по картинам канализования электронов не выявило наличия в них каких-либо диэлектрических прослоек с размерами $\geq 2-3$ мкм. Ориентация разных участков кристаллов, как в торцевых плоскостях *ac* и *bc*, так и в плоскости *ab*, также, как и параметры кристаллической решетки с точностью измерений остаются неизменными.

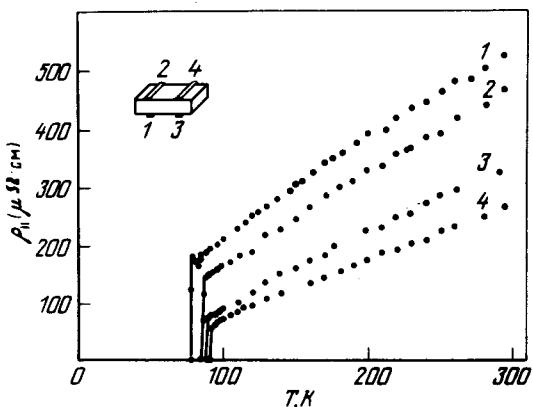


Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления в плоскости *ab* четырех моно-кристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6-x}$. На вставке показан способ размещения контактов.

Было выяснено, что понижение температуры перехода, регистрируемого по исчезновению ρ_{\perp} , связано с конечной величиной измерительного тока. Если при 80 К увеличивать ток I_{\perp} через контакты 34, напряжение на контактах 12 появляется в кристалле № 2 machine с $I_{\perp} \approx 1$ мА, а в кристалле № 4 — с $I_{\perp} \approx 2$ мА. При этих (и гораздо больших) токах в продольном направлении кристаллы остаются еще сверхпроводящими. Для кристалла № 1 температурная зависимость поперечного критического тока представлена на рис. 3. Из него видно, что при $I_{\perp} \rightarrow 0$ температура перехода стремится к той же величине 80 К, которая получается при измерении ρ_{\parallel} .

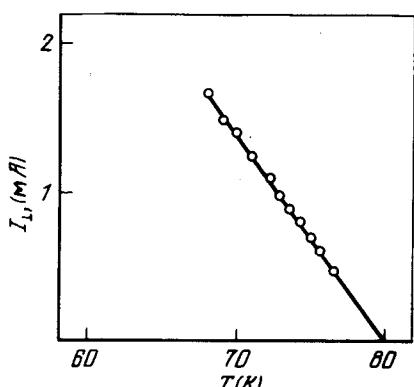
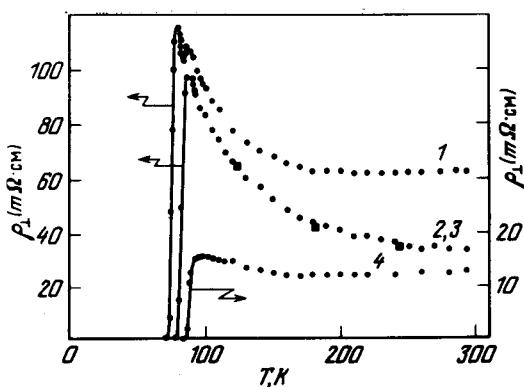


Рис. 2

Рис. 3

Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления в направлении оси *c*. Черными квадратиками показано несколько точек, относящихся к кристаллу № 3

Рис. 3. Температурная зависимость критического тока в направлении оси *c* для кристалла № 1

Величина критической плотности тока в направлении оси *c*, соответствующая этим результатам, оказывается $\lesssim 1 \text{ A/cm}^2$, что снова много меньше тех значений, которые были получены в⁷ по измеренным величинам максимального диамагнитного момента. По нашему мнению, это расхождение опять указывает на значительную неоднородность кристаллов в направлении оси *c*, приводящую к образованию множественных джозефсоновских переходов.

Выяснение природы этой неоднородности требует дальнейших исследований. Фактором, способствующим ее возникновению, может являться большая анизотропия скорости роста кристалла в различных кристаллографических направлениях. Это может приводить, например, к чередованию слоев с различным локальным содержанием кислорода.

Во время подготовки настоящей статьи к печати появилась работа⁸, в которой анизотропия удельного сопротивления была измерена на монокристалле $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ с $\rho_{||}(293) = 460 \text{ мкОм} \cdot \text{см}$. Величина ρ_{\perp} этого кристалла при 293 К близка к значению ρ_{\perp} нашего кристалла № 4 и возрастает к точке перехода \sim на 35%. Авторы⁸ полагают, что этот рост является собственным и считают, что отношение $\rho_{\perp}/\rho_{||}$ при температурах вблизи T_c , равное 90, неплохо согласуется с оценкой этой величины по анизотропии H_{c2} , измеренной в⁶. Наши данные о малой величине критического тока в поперечном направлении делают этот вывод сомнительным.

Литература

1. Bednorz J.G., Müller K.A. Z. Phys. B. 1980, **64**, 189.
2. Wu M.K., Ashburn J.R., Torng C.T. et al. Phys. Rev. Lett., 1987, **58**, 908.
3. Емельченко Г.А., Карцовник М.В., Кононович П.А. и др. Письма в ЖЭТФ, 1987, **46**, 162.
4. Montgomery H.C. J. Appl. Phys., 1971, **42**, 2971.
5. Буравов Л.И. ЖТФ, 1987, в печати.
6. Worthington T.K., Gallagher W.J., Dinger T.R. Phys. Rev. Lett., 1987, **59**, 1160.
7. Dinger T.R., Worthington T.K., Gallagher W.J., Sandstrom R.L. Phys. Rev. Lett., 1987, **58**, 2687.
8. Tozer S.W., Kleinsasser A.W., Penney T. et al. Phys. Rev. Lett., 1987, **59**, 1768.